

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成20年1月10日(2008.1.10)

【公表番号】特表2007-513229(P2007-513229A)

【公表日】平成19年5月24日(2007.5.24)

【年通号数】公開・登録公報2007-019

【出願番号】特願2006-541846(P2006-541846)

【国際特許分類】

C 0 8 G 64/30 (2006.01)

【F I】

C 0 8 G 64/30

【手続補正書】

【提出日】平成19年11月13日(2007.11.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

純粋なオニウム触媒によってジヒドロキシアリアル化合物およびジアリアルカーボネートから溶融トランスエステル化法によって得られる、低モノマー含量のポリカーボネートの製造方法であって、既存の多段階製造ラインにおいて、最終反応段階に移行する前に標的の分子量を確立すること、使用された触媒の量に対して測定して化学量論量よりも少ない量の停止剤の添加によって縮重合を停止すること、および最終反応段階においてモノマーを減量することを特徴とする製造方法。

【請求項2】

最大分子量 $M_w 30,000$ を最終の値として得ることを特徴とする、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

最終反応器の前でOH末端基の含量を $70 \sim 500$ ppm に調整することを特徴とする、請求項1および2に記載の方法。

【請求項4】

酸物質が、オルトリン酸およびオルトリン酸の酸エステルの群から選択されることを特徴とする、請求項1および2に記載の方法。

【請求項5】

請求項1～4に記載の方法によって得ることができるポリカーボネート。

【請求項6】

ポリカーボネートが 350 ppm 未満のジフェニルカーボネート、 40 ppm 未満の2,2-ビス-(4-ヒドロキシフェニル)プロパンおよび 150 ppm 未満のフェノールを含有する、請求項5に記載のポリカーボネート。